窒素をデルタドープした GaAs の3パルスフォトンエコー測定

Three-pulse photon echo measurements on nitrogen delta-doped GaAs 筑波大物理¹,物材機構² ^O田久保 悠一¹,石澤 輝¹,佐久間 芳樹²,池沢 道男¹ Tsukuba Univ.¹, NIMS², ^oYuichi Takubo¹, Hikaru Ishizawa¹, Yoshiki Sakuma², Michio Ikezawa¹

E-mail: s1720264@s.tsukuba.ac.jp

GaAs 中に希薄にデルタドープされた窒素不純物によって形成される発光中心は、数百 ps 程度 の短い寿命を持つ明るい単一光子源として有用である[1,2]。我々は以前、これらの窒素発光中心 に束縛された励起子のコヒーレンスを評価するために、2 パルスのヘテロダイン検出縮退四光波 混合法(FWM)を用いてフォトンエコー信号を観測し、位相緩和時間を測定した[3]。今回、3 パル スによる誘導エコーを観測したので報告する。

試料は、MOCVD 法で GaAs(100)基板上に窒素デルタドープ層を1層成長させたものである。窒 素ドープ量は、個々の発光中心を通常の顕微分光法で分解できる程度に低濃度としている。励起 にはパルス幅約 2ps、繰り返し周期 82MHz の Ti:S レーザーを用いた。FWM 信号検出には反射配 置で3ビーム同軸入射のヘテロダイン検出法を用いた。各励起パルスおよび参照パルスに対して 音響光学素子を用いて 110MHz 前後の周波数シフトを与え、スペクトラムアナライザーで FWM 光と参照光の干渉の周波数のみを選んで検出した。試料温度は 2K である。

図(a)に試料の発光スペクトルを示す。1510meVより低エネルギー側にあるなだらかな発光帯が、

窒素ドープによって形成された発光中心による鋭 い発光スペクトルの集合であることは、顕微 PL 測 定により確認されている。1500meV より低エネル ギー側ではカーボンアクセプタに起因する発光が 重畳している。点線で示すようなスペクトルのパ ルスで励起した際に、図(b)に示すように、第三パ ルスからτ12だけ遅れた位置に明瞭な誘導エコー信 号が観測された。パルス間隔τ12またはτ23を掃引す る事によって、図(c)に示すようなエコー信号の指 数関数的な減衰が見られ、ここからそれぞれ T₂と T₁が得られる。T₂に関しては2パルスでの測定[3] と同程度であった。縦緩和時間 T₁は、₁₂を大きく すると短くなることが分かった(図(d))。これは第 ーパルスと第二パルスで形成されるポピュレーシ ョングレーティングがスペクトル拡散によって弱 められる効果に対応すると考えられる。

【謝辞】本研究は、科学研究費補助金(課題番号 17H02909)の助成を受けて行われた。



図: (a) 試料の2K における PL スペクトルと励 起レーザーのスペクトル (b) 3 パルスエコ ー信号の例(τ₁₂=τ₂₃=20ps) (c) T₁ (赤色),T₂(青 色)測定結果 (d) T₁のτ₁₂依存性

- Y. Sakuma, M. Ikezawa and L. Zhang, Micro- and Nanophotonic Technologies, pp.125-138, Wiley-VCH (2017).
- [2] M. Ikezawa et al., Appl. Phys. Lett. 100, 042106 (2012); M. Ikezawa et al., Appl. Phys. Lett. 110, 152102 (2017).
- [3] 福島ほか、第65回応用物理学会春季学術講演会、18p-P8-3 (2018).